PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-244265

(43)Date of publication of application: 02.09.1994

(51)Int.Cl.

H01L 21/68 B65G 49/00

(21)Application number: 05-031056

(71)Applicant : O S GIKEN KOGYO:YUGEN

(22)Date of filing:

22.02.1993

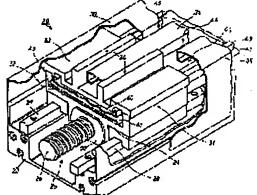
(72)Inventor: SEGAWA OSAMU

(54) TRANSFER ROBOT

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a clean slider, which is capable of corresponding to a superclean room of a cleanness of class of 10 or lower, by a method wherein partition plates, which are made to fit the gap between lower and upper transfer tables, are bridged in the direction of a ball screw extending over the whole region of the advancing and retreating operation of the transfer tables and the like.

CONSTITUTION: A transfer robot has a box-shaped frame base 22, a ball screw 25, two support frames 27 and 28, a transfer table placed on a nut 29 of the screw 25 and covers 27 to 39 covering the open surface and the side surfaces of the base 22 in such a way that the tops 34 only of the transfer table are made to project from the covers. In such the transfer robot, the transfer table is constituted of a lower transfer table, which is supported by the frames 27 and 28 and at the same time, is placed on the nut 29, and an upper transfer table 33, which is jointed with the lower transfer table at both



side parts thereof parallel to a screw axis 26 and at the same time, is provided with a gap 32 between the lower transfer table and the table 33. Moreover, partition plates 40 and 41, which are made to fit the gap 32, are bridged in the direction of the ball screw 25 extending over the whole region of the advancing and retreating operation of the table 33 and the lower transfer table.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.02.1993

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2505361

[Date of registration]

02.04.1996

[Number of appeal against examiner's decision

af raination]

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

FΙ

(11)特許出願公開番号

特開平6-244265

(43)公開日 平成6年(1994)9月2日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

技術表示箇所

HO1L 21/68

A 8418-4M

B 6 5 G 49/00

A 9244-3F

請求項の数1 OL (全 6 頁) 審査請求 有

(21)出願番号

特願平5-31056

(22)出願日

平成5年(1993)2月22日

(71)出願人 390028853

有限会社オーエス技研工業

群馬県邑楽郡大泉町北小泉3丁目19番10号

(72)発明者 瀬川治

群馬県邑楽郡大泉町北小泉3丁目19番10号

有限会社オーエス技研工業内

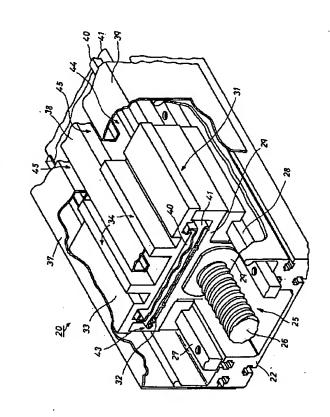
(74)代理人 弁理士 羽鳥 亘

(54)【発明の名称】 搬送ロボット

(57)【要約】

【目的】 クラス10以下のスーパークリーンルームに 対応可能な搬送ロボットのクリーンスライダーを提供す る。

【構成】 搬送ロボットのクリーンスライダー20は、 一方が開放された箱形フレーム基台22と、該フレーム 基台内部に配設された駆動モータ(図示略)によるボー ルネジ25と、ボールネジ25のネジ軸26と平行に敷 設された二本の支持レール27、28と、前記支持レー ルに支持されるとともにネジ軸26によって進退動する ボールネジのナット29に載置された下部搬送台30 と、前記ネジ軸26と平行な両側辺部31で下部搬送台 30と接合され、下部搬送台30との間に空隙32を設 けた上部搬送台33と、該上部搬送台33の頂部34の みが突出するようにフレーム基台22の開放面とこれに 隣接する側面を覆設するカバー37、38、39と、を 有し、更に前記空隙32を嵌通する仕切板40、41が 搬送台の進退動の全領域に渡ってボールネジ方向に架設 した構成である。



20

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一方が開放された箱形フレーム基台と、該フレーム基台内部に配設された駆動モータによるボールネジと、前記ボールネジのネジ軸と平行に敷設された二本の支持レールと、前記支持レールに支持されるとともにネジ軸によって進退動するボールネジのナットに載置された搬送台と、前記搬送台の頂部のみが突出するように前記箱形フレーム基台の開放面とこれに隣接する側面を覆設するカバーと、を有する搬送ロボットにおいて、前記搬送台を前記支持レールに支持されるとともに下前記ナットに載置された下部搬送台と、前記ネジ軸と平行な両側辺部で前記下部搬送台と接合されるとともに下部搬送台との間に空隙を設けた上部搬送台と、により構成し、且つ前記空隙を嵌通する仕切板を上部搬送台及び下部搬送台の進退動の全領域に渡ってボールネジ方向に架設したことを特徴とする搬送ロボット。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、主として半導体製造ライン等の空気中に浮遊する微粒子が規定数以下に制御された所謂クリーンルームにおいて、物品の直線的送り駆動系に用いる搬送ロボット(スライダーとも称される。)に関するものである。

[0002]

【従来の技術】近年の半導体電子産業の発展は著しく、あらゆる自動車や電気製品に半導体デバイスが搭載されており、鉄鋼に代わる「産業の米」と言われて久しい。【0003】上記LSIをはじめとする半導体デバイスの製造工程において、現在は0.1μm単位の微細加工技術を駆使してシリコン結晶やガリウムーヒソ結晶のウェハーに各種FETトランジスタや配線、絶縁膜等の微細パターニングが行われているが、この微細加工工程においては空気中に浮遊する目に見えない塵埃粒子が工程途中に上記ウェハーに付着することによってウェハーにパターン欠陥が生じてしまい半導体デバイスのウェハー処理工程(一般に前工程と称される。)の不良率の主たる原因となっている。

【0004】したがって、上記パターン欠陥の防止にはウェハー処理工程のクリーン化が絶対必要不可欠であり、現在の微細加工技術に対しては所謂クリーン度の指 40 標として、クラス10以下の製造工程ライン(スーパークリーンルーム)が要求されている。

[0005]とこで、クラス10とは1フィート四方の空間内に存在する 0.1μ mレベルの塵埃粒子数が10個を越えないように維持管理されている空間のクリーン度を指す。

【0006】上記クリーン度の実現のため、半導体デバイス製造工程から発塵の主原因である人を排し、極力無人化して製造工程の流れに合わせて各種処理装置を連続的に構成したクリーントンネルが採用されている。

【0007】上記クリーンルームないしクリーントンネルにおいては、ウェハーの各処理工程での処理装置への搬入・搬出及び各工程間の移送を搬送ロボットにて行うのが一般的である。

【0008】上記搬送ロボットにおいても当然にスーパークリーンルームと同等のクリーン度が要求されるが、特に直線的な搬送に用いられるスライダーと称される搬送ロボットは搬送の際に駆動系の部材から不可避的に塵埃粒子(例えばネジ、ナット、ベルト等の摩耗による切り屑、潤滑油の飛散等々)が発生して搬送ロボットの外へ拡散してしまうので、クリーンルーム等での使用に際しては何らかのスライダー外への塵埃粒子拡散に対する防止対策が必要である。

【0009】との点、従来のスライダーは上記塵埃粒子拡散防止対策として、スライダー内部の駆動系で発生する塵埃粒子を局所的に設けた排気ダクトを通して常時真空ポンプにて吸引することで塵埃粒子がスライダーの外へ拡散しないようにする方法が採られていた。

[0010]図4は上記従来の搬送ロボット(スライダー)の進退動領域での搬送方向に対して直角な断面における構造を示す横断面図である。

【0011】図においてスライダー1は一方(上方)が開放された箱形フレーム基台2と、該フレーム基台内部に配設された駆動モータ(図示略)によるボールネジ5と、ボールネジのネジ軸6と平行に敷設された二本の支持レール7、8と、前記支持レール7、8に支持されるとともにネジ軸6によって進退動するボールネジのナット9に載置された搬送台10と、前記搬送台10の頂部11のみが突出するようにフレーム基台2の開放面とこれに隣接する側面を覆設するカバー14、15、16と、を有する構成である。

【0012】尚、上記スライダーの幅は160mm程度で、搬送台は進退動方向の幅120mm程度、進退動の移送距離は100mmから数メートル程度まで各種市販されている。

【0013】尚、局所排気ダクトの排気口が、例えばフレーム基台底部3の一部に設けられており、外部に配設された真空ポンプにて常時スライダー内部の空気を吸引してスライダー内部の駆動系にて発生した塵埃粒子を集塵することが一般に塵埃粒子の拡散防止対策として行われている。

[0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、ボールネジ5のネジ軸6とナット9との嵌合部に組み込まれた多数の鋼球やネジ溝の摩耗による及び支持レール7、8と搬送台10との接触面にて搬送動作時に発生する塵埃粒子(金属屑、潤滑油等の微粒子)は舞い上がって図中の矢印のように直接に搬送台10のカバー14より突出する頂部11が進退動するためのスライド隙間17、1508を通過してスライダー外へ拡散する数が相当数存在す

る。これは局所排気ダクトをスライダーの一部に設ける ことにより該局所排気ダクト近傍での吸引効果が得られ ても、離れた所での吸引効果は落ちてしまい、十分に駆 動系にて発生した塵埃粒子を集塵できていないことが原 因である。

【0015】したがって、従来のスライダー構造におい ては超LSIのような半導体製造ラインが配備されるク ラス10以下のスーパークリーンルームに対応すること が難しいという問題点があった。

せる必要があり、クリーンルームないしクリーントンネ ル内の製造ラインの構成、管理が複雑になってしまうと いう問題点があった。

【0017】本発明は、上記事情に鑑みてなされたもの であり、局所排気ダクトを配設せずにスライダー内部の 駆動系で発生する塵埃粒子をスライダー内部に滞留させ てスライダーの外へ拡散しないような構造としてクラス 10以下のクリーン度を実現した搬送ロボット(クリー ンスライダーとも称す。)を提供するものである。

[0018]

【課題を解決するための手段】本発明は、一方が開放さ れた箱形フレーム基台と、該フレーム基台内部に配設さ れた駆動モータによるボールネジと、前記ボールネジの ネジ軸と平行に敷設された二本の支持レールと、前記支 持レールに支持されるとともにネジ軸によって進退動す るボールネジのナットに載置された搬送台と、前記搬送 台の頂部のみが突出するように前記箱形フレーム基台の 開放面とこれに隣接する側面を覆設するカバーと、を有 する搬送ロボットにおいて、前記搬送台を前記支持レー ルに支持されるとともに前記ナットに載置された下部搬 30 送台と、前記ネジ軸と平行な両側辺部で前記下部搬送台 と接合されるとともに下部搬送台との間に空隙を設けた 上部搬送台と、により構成し、且つ前記空隙を嵌通する 仕切板を上部搬送台及び下部搬送台の進退動の全領域に 渡ってボールネジ方向に架設したことを特徴とする搬送 ロボットを提供することにより、上記目的を達成するも のである。

[0019]

【作用】本発明においては、塵埃粒子がスライダー外へ 拡散するに到るまでの拡散経路において、スライダー内 40 部空間をカバーと仕切板とフレーム基台側面にておよそ 三分割してあり、塵埃粒子の拡散が防止される。

【0020】即ち、第一の空間に配設された駆動系にて 発生した塵埃粒子が舞い上がってフレーム基台側面と仕 切板との隙間(下部搬送台と上部搬送台の側辺部の接合 部分のスライド領域)を通過して第二の空間に到達して も、更に舞い降りて仕切板とカバーとの隙間を通過して 第三の空間(上部搬送台の仕切板上のスライド部分)に 到達する塵埃粒子は激減する。また更に第三の空間に到 達した塵埃粒子が上部搬送台のカバーより突出する頂部 50 ボモータや5相ステッピングモータが高い応答性と位置

のスライド部分の隙間を通過してスライダー外へ拡散す ることは殆ど無くなる。

【0021】換言すれば、塵埃粒子が駆動系で発生して もスライダー外に塵埃粒子が拡散するには、スライダー 内部の前記仕切られた空間の複数の隙間を舞い上がり、 舞い降りを繰り返して通過しなければならなくなって、 いわば迷路を辿らなければスライダー外に到達しない。 【0022】上記の迷路を経る間に塵埃粒子はスライダ -内部の壁面に付着するか各空間内に浮遊した状態を保 【0016】さらに、上記局所排気ダクトは常時作動さ 10 つのでスライダー外に拡散する塵埃粒子は殆ど無く、塵 埃粒子はスライダー内部に滞留する。

> 【0023】したがって、局所排気ダクトを設ける必要 がなくなり、製造ラインの構成が簡素になる。

[0024]

【実施例】本発明の実施例を、図面に基いて詳細に説明 する。

【0025】図1は本発明に係わる搬送ロボット(以下 クリーンスライダーと称する。)の内部構造を示す斜視 図であり、図2は搬送方向と直角な断面を表す断面図で 20 ある。図3は上記クリーンスライダーの外観を示す斜視 図である。

【0026】先ず、本実施例のクリーンスライダーの構 造を詳細に説明する。

【0027】図1及び図2においてクリーンスライダー 20は、一方が開放された箱形フレーム基台22と、該 フレーム基台内部に配設された駆動モータ(図示略)に よるボールネジ25と、ボールネジ25のネジ軸26と 平行に敷設された二本の支持レール27、28と、前記 支持レールに支持されるとともにネジ軸26によって進 退動するボールネジのナット29に載置された下部搬送 台30と、前記ネジ軸26と平行な両側辺部31で下部 搬送台30と接合され、下部搬送台30との間に空隙3 2を設けた上部搬送台33と、該上部搬送台33の頂部 34のみが突出するようにフレーム基台22の開放面と これに隣接する側面を覆設するカバー37、38、39 と、を有し、更に前記空隙32を嵌通する仕切板40、 41が搬送台の進退動の全領域に渡ってボールネジ方向 に架設した構成である。

【0028】との際、上記ボールネジ25は摩擦抵抗が 小さく、高い機械効率と位置決め精度を得ることができ るメカニカルな回転/直線運動変換装置として、一般に 半導体製造装置やNC工作機械の送り駆動系に使用され ているものであって、ネジ軸26とナットの間に多数の 鋼球が組み込まれており、一般にはネジ運動につれて鋼 球は転動しながらリターンチューブを経て循環運動する 構造となっている送り駆動系である(尚、上記循環運動 方式はリターンチューブ方式の他にデフレクタ方式やガ イドプレート方式がある。)。

【0029】また、駆動モータとしてはAC/DCサー

決め機能を有するので適当であり、例えば図3における クリーンスライダー20の一方の端(手前)内部に密閉 した状態にて配置され、配線接続用コネクタ47にて外 部の制御系と結線される。

【0030】各カバー37、38、39はアルミ合金板 やステンレス板が望ましいが用途によっては合成樹脂製 であってもよい。

【0031】フレーム基台22は例えば高い寸法精度が 得られ大量生産に適したダイカスト鋳造法にて成型した アルミニウム合金製もしくは亜鉛合金製である。

【0032】次に、クリーンスライダー20の内部の駆 動系で発生する塵埃粒子のスライダー外への拡散を防止 する機構について詳述する。

【0033】本実施例のクリーンスライダー構造におい ては、塵埃粒子がクリーンスライダー外へ拡散するに到 るまでの拡散経路において、内部空間がカバー37、3 8、39と仕切板40、41とフレーム基台22の側面 にておよそ三分割されており、該空間分割により塵埃粒 子のスライダー外部への拡散が難しい状態を作出してい

【0034】即ち、第一の空間Aに配設されたボールネ ジの駆動系にて発生した塵埃粒子が図2の矢印のように 舞い上がってフレーム基台22側面と仕切板41とのス ライド隙間43(下部搬送台30の側辺部のスライド領 域)を通過して第二の空間Bに到達しても、更に舞い降 りて仕切板41とカバー37、39とのスライド隙間4 4を通過して第三の空間C(上部搬送台の仕切板上のス ライド部分) に到達する塵埃粒子は激減する。また更に 第三の空間 C に到達した塵埃粒子が上部搬送台33のカ バーより突出する頂部34のスライド隙間45を通過し 30 を有する。 てクリーンスライダー外へ拡散することは殆ど無くな る。

【0035】換言すれば塵埃粒子が第一の空間Aに配備 された駆動系で発生してもクリーンスライダー20の外 に塵埃粒子が拡散するに到るまでには、スライダー内部 の前記仕切られた第二、第三の空間に到達することが必 要であり、複数のスライド部分の隙間43、44、45 を舞い上がり、舞い降りを繰り返して図2の矢印のよう な拡散経路で通過しなければならない。したがって、い わば限られた迷路を辿ってのみスライダー外に到達する 40 ような構成になっているのである。

【0036】上記の経路を辿る間に塵埃粒子は壁面に付 着するか各空間内に浮遊したままの状態を保つのでスラ イダー外に拡散する塵埃粒子は殆ど無く、塵埃粒子はス ライダー内部に滞留する。

【0037】本発明者のパーチクルカウンターによる従 来との比較実験によれば、従来のスライダーが局所排気 ダクトを働かしているにもかかわらず数十個レベル以上 の塵埃粒子の検出がなされたのに対し、本クリーンスラ イダーにおいては殆ど塵埃粒子が検出されず、クラス1 50 0以下のクリーン度の達成が十分実現されることが確認 された。

【0038】したがって本クリーンスライダー20はク ラス10以下のスーパークリーンルームでの使用が可能 となり、また別個に局所排気ダクトを設ける必要がな く、製造ラインの構成が簡素になる。

【0039】尚、本実施例においては仕切板40、41 にてクリーンスライダー20内部の塵埃粒子の経路空間 をABCの三分割にしているが、搬送台の構造を上部搬 10 送台33と下部搬送台30の二段構造から三段構造、四 段構造として各段部に設けた空隙に仕切板を嵌通架設 し、また各スライド隙間を狭めれば、更に塵埃粒子の拡 散迷路は複雑目つ通過しにくくなってスライダー外部に 到達する虞が皆無となることは言うまでもない。

【0040】尚本発明の要旨から敷延すれば、上記搬送 ロボットの送り駆動系としてはボールネジに限る必要は なく、一般に用いられている送りネジ方式やタイミング ベルト方式、またはラックピニオン方式等の回転/直線 運動変換装置にも容易に採用が可能であることは言うま 20 でもない。

[0041]

【発明の効果】本発明に係わる搬送ロボット(クリーン スライダー) は上記のように構成されているため、以下 に記するような効果を有する。

【0042】(1)クリーン度がクラス10以下のスー バークリーンルームに対応可能という優れた効果を有す る。

【0043】(2)排気ダクトが不要であり、クリーン ルーム内の製造ラインが簡素化されるという優れた効果

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係わる搬送ロボット(クリーンスライ ダー)の内部構造を示す内部斜視図。

【図2】本発明に係わるクリーンスライダーの搬送方向 と直角な断面を表す断面図である。

【図3】本発明に係わるクリーンスライダーの外観を示 す斜視図である。

【図4】従来の搬送ロボット (スライダー) の内部構造 を示す断面図である。

【符号の説明】

スライダー 1

2 フレーム基台

ボールネジ 5

6 ネジ軸

支持レール 7, 8

ナット 9

10 搬送台

1 1 頂部

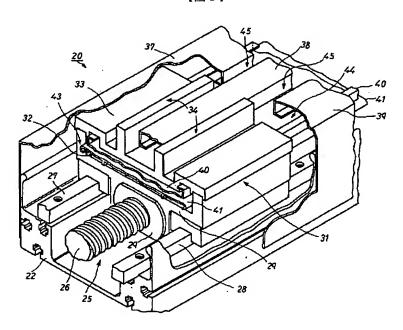
17, 18

14, 15, 16 カバー

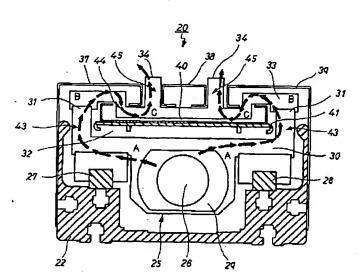
スライド隙間

20 クリーンスライダー	* 3 3 上部 搬送 台	
22 フレーム基台	3 4 頂部	
25 ボールネジ	37、38、39 カバ	'-
26 ネジ軸	40、41 仕切板	
27、28 支持レール	43、44、45 ステ	ライド隙間
29 ナット	47 コネクタ	
30 下部搬送台	A 第一の空間	
3 1 側辺部	B 第二の空間	
3 2 空隙	* C 第三の空間	

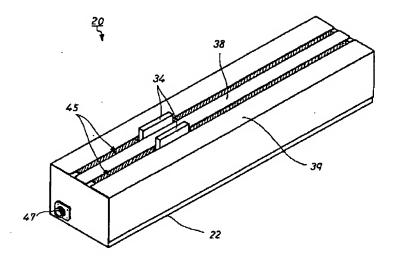
【図1】



【図2】



【図3】



[図4]

